

H05H プラズマ技術 (X線の発生に特に適した装置と方法 H 0 5 G 2 / 0 0); 加速された荷電粒子のまたは中性子の発生; 中性分子または原子ビームの発生または加速

注

注 [3]

(1) このサブクラスは、以下のものを包含する：

(a) プラズマの発生または取扱い；

(b) 電子，イオンビームまたは中性粒子を加速する装置；

(c) 中性粒子ビームを発生させるための装置；

(d) (a) , (b) , または (c) のためのターゲット

(2) このサブクラスは、サブクラス H 0 1 J が包含する放電管または放電ランプ内で電子またはイオンの流れを生成、加速、影響、または利用するための装置を包含しない。

サブクラス内の索引

プラズマ技術..... 1/00

中性粒子ビームの発生と加速..... 3/00

核反応を起すためのターゲット..... 6/00

粒子加速器

直流電圧型加速器；単一パルスを用いる加速器..... 5/00

線型；磁気誘導型；磁気共振型..... 9/00；11/00；13/00

その他..... 15/00

細部..... 7/00

1/00 プラズマの生成；プラズマの取扱い (熱核融合炉へのプラズマ技術の応用 G 2 1 B 1 / 0 0)

1/02 ・電界または磁界あるいはそれらによってプラズマを閉じ込めるための装置；プラズマを加熱するための装置 (電子光学 H 0 1 J)

1/03 ・静電界を用いるもの [3]

1/04 ・プラズマ中の放電によって発生する磁界を用いるもの

1/06 ・直線ピンチプラズマ発生装置

1/08 ・誘導ピンチ (ピンチ) プラズマ発生装置

1/10 ・磁界のみを用いるもの

1/11 ・カスプ配位を用いるもの (H 0 5 H 1 / 1 4 が優先) [3]

1/12 ・閉ループ形状の容器を用いるもの，例．ステラレイタ

1/14 ・容器が直線状で磁気鏡をもつもの

1/16 ・電界と磁界を用いるもの

1/18 ・超高周波，例．マイクロ波領域，の振動電界および磁界を用いるもの

1/20 ・オーム加熱

1/22 ・入射加熱のためのもの

1/24 ・プラズマの発生 [2]

1/26 ・プラズマトーチ [2]

1/28 ・冷却装置 [3]

1/30 ・電磁界を用いるもの，例．高周波ま

たはマイクロ波エネルギー (H 0 5 H 1 / 2 8 が優先) [3]

1/32 ・アークを用いるもの (H 0 5 H 1 / 2 8 が優先) [3]

1/34 ・細部，例．電極，ノズル [3]

1/36 ・回路装置 (H 0 5 H 1 / 3 8 , H 0 5 H 1 / 4 0 が優先) [3]

1/38 ・電極の案内またはセンタリング [3]

1/40 ・磁界を用いるもの，例．アークを集束または回転させるためのもの [3]

1/42 ・プラズマ中に材料，例．粉末または液体，を導入するための設備を有するもの [2 0 0 6 . 0 1]

1/44 ・複数のトーチを用いるもの [3]

1/46 ・電磁界を用いるもの，例．高周波またはマイクロ波エネルギー (H 0 5 H 1 / 2 6 が優先) [3]

1/48 ・アークを用いるもの (H 0 5 H 1 / 2 6 が優先) [3]

1/50 ・そして磁界を用いるもの，例．アークを集束または回転させるためのもの [3]

1/52 ・イクスプロウディングワイヤまたはスパークギャップを用いるもの (H 0 5 H 1 / 2 6 が優先) [2 0 0 6 . 0 1]

1/54 ・プラズマの加速 [3]

3/00 中性粒子ビーム，例．分子または原子ビームの発生または加速 [3]

3/02 ・分子ビームまたは原子ビームの発生，例．共振ビーム発生 [2 0 0 6 . 0 1]

3/04 ・電磁波圧力による加速 [3]

3/06 ・中性子ビームを発生するもの (核反応を起こすためのターゲット H 0 5 H 6 / 0 0 ; 中性子源 G 2 1 G 4 / 0 2) [5]

5/00 直流電圧型加速器；単一パルスを用いる加速器 (H 0 5 H 3 / 0 6 が優先) [5]

5/02 ・細部 (核反応を起こすためのターゲット H 0 5 H 6 / 0 0) [3]

5/03 ・加速管 [2 0 0 6 . 0 1]

5/04 ・静電発電機により，例．バンデグラフ発電機により，加速されるもの [4]

5/06 ・タンデム型加速器；多段型加速器

5/08 ・昇圧トランス，例．共振トランス，を使用する粒子加速器 [4]

6/00 核反応を起こすためのターゲット (照射されるターゲットまたは物体の支持具 G 2 1 K 5 / 0 8) [3]

7/00 グループ H 0 5 H 9 / 0 0 ~ H 0 5 H 1 3 / 0 0 によって包含される型の装置の細部 (核反応を起こすためのターゲット H 0 5 H 6 / 0 0) [3]

H 0 5 H

- 7/02 ・高周波エネルギーを供給するための回路および方式 [2 0 0 6 . 0 1]
- 7/04 ・磁石装置；磁石装置の励磁
- 7/06 ・2 ビーム装置；多ビーム装置
- 7/08 ・粒子を軌道に入射させるための装置
- 7/10 ・粒子を軌道から放出させるための装置
- 7/12 ・ビームの最終エネルギーを変更させる装置
- 7/14 ・真空室 (H 0 5 H 5 / 0 3 が優先) [4]
- 7/16 ・ ・導波管型のもの [4]
- 7/18 ・ ・空洞；共振器 [4]
- 7/20 ・ ・ ・超電導壁を有するもの [4]
- 7/22 ・線型加速器の細部，例．ドリフト管 (H 0 5 H 7 / 0 2 ~ H 0 5 H 7 / 2 0 が優先) [4]
- 9/00 線形加速器 (H 0 5 H 1 1 / 0 0 が優先)
- 9/02 ・進行波型線形加速器
- 9/04 ・定在波型線形加速器
- 11/00 磁気誘導型加速器，例．ベータトロン
- 11/02 ・空心型ベータトロン
- 11/04 ・偏倚型ベータトロン
- 13/00 磁気共振型加速器；サイクロトロン
- 13/02 ・シンクロサイクロトロン，例．F Mサイクロトロン
- 13/04 ・シンクロトロン
- 13/06 ・空心型磁気共振型加速器
- 13/08 ・A G磁気共振型加速器
- 13/10 ・荷電粒子を最初の加速部に平行な軌道に戻すための1つまたは複数の線型加速部および湾曲磁石または類似のものから成る加速器，例．マイクロトロン [4]
- 15/00 荷電粒子の他に分類されない加速方法または装置 [4]